

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年2月5日(05.02.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/016099 A1

- (51) 国際特許分類:
C25D 1/00 (2006.01) *G01R 1/073* (2006.01)
G01R 1/067 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/069339
- (22) 国際出願日: 2014年7月22日(22.07.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-161824 2013年8月2日(02.08.2013) JP
- (71) 出願人: オムロン株式会社(OMRON CORPORATION) [JP/JP]; 〒6008530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者: 逸見 幸伸 (HEMMI, Yoshinobu); 〒6008530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 オムロン株式会社内 Kyoto (JP). 酒井 貴浩 (SAKAI, Takahiro); 〒6008530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 オムロン株式会社内 Kyoto (JP). 尾崎 英朗 (OZAKI, Hideaki); 〒6008530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 オムロン株式会社内 Kyoto (JP).

寺西 宏真(TERANISHI, Hirotada); 〒6008530 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地 オムロン株式会社内 Kyoto (JP).

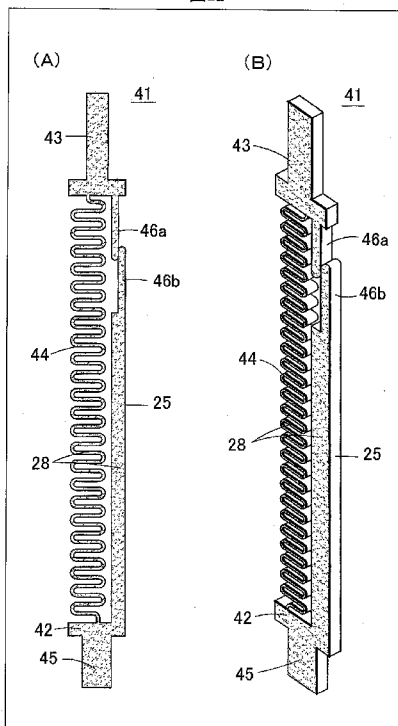
- (74) 代理人: 増井 義久, 外(MASUI, Yoshihisa et al.); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル4F Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ユーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) Title: ELECTROFORMED COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 電鍍部品及びその製造方法

図22



(57) Abstract: A contact element (25) (electroformed product) is manufactured by electroforming. An insulating film (28), formed using a dry film resist or the like, is provided on the surface of the contact element (25). The insulating film (28) is provided in a process following the forming of the contact element (25) in the manufacturing process for the contact element (25). Thus, an electroformed component where electroformed products can be lined up at a narrow pitch while preserving insulation between the electroformed products (contact elements) is provided.

(57) 要約: コンタクト素子(25)(電鍍成形品)は、電鍍法により製造されている。コンタクト素子(25)の表面には、ドライレフィルムジストなどを用いて形成された絶縁被膜(28)が設けられている。絶縁被膜(28)は、コンタクト素子(25)の製造工程において、コンタクト素子25の製造後の工程において設けられている。これにより、電鍍成形品(コンタクト端子)どうしの絶縁性を保ちながら、電鍍成形品どうしを狭ピッチで並べることのできる電鍍部品を提供する。

NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI 添付公開書類:
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
MR, NE, SN, TD, TG).